

통합형 Ptfе 오버플로우 탱크 이음매 없는 산 세정조 맞춤형 불소중합체 반도체 세정 싱크

품목 번호: PL-CP388



소개

극한의 내화학성 및 고순도 응용 분야를 위해 설계된 고성능 PTFE 오버플로우 탱크 및 이음매 없는 세정조입니다. 완전히 맞춤화 가능한 통합 설계는 오늘날 모든 산업체 운영자가 요구하는 산업용 산 에칭 및 반도체 세정 공정에서 누설을 방지하고 최대의 내구성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 세정	RCA 또는 피라니아 에칭을 사용하여 실리콘 웨이퍼에서 유기 및 무기 오염물질을 중요하게 제거합니다.	초고순도로 미량 금속 오염이 없음을 보장합니다.
태양전지 셀 에칭	농축산 또는 알칼리 용액을 사용하여 태양등급 실리콘의 정밀 표면 텍스처링을 수행합니다.	이음매 없는 설계는 텍스처링 화학 물질의 공격적인 특성에 견딥니다.
금속 표면 피클링	정밀 금속 부품 및 의료용 임플란트에서 산화물 및 스케일을 고성능으로 제거합니다.	장기적인 내구성은 부식 환경에서 장비 교체 비용을 줄여줍니다.
미량 분석 실험 기구	10억분율(ppb) 정확도가 요구되는 환경에서 샘플을 준비하고 보관합니다.	비용출성 재료는 분석 중 샘플 간섭을 방지합니다.
배터리 연구 및 개발	차세대 배터리 아키텍처에 사용되는 전해질 및 부식성 화학 물질을 테스트하고 보관합니다.	탁월한 내열성은 발열 반응을 안전하게 처리합니다.
전기 도금 및 양극 산화	고순도 및 내화학성이 필수적인 특수 도금조용 보관 탱크입니다.	통합 오버플로우는 균일한 코팅을 위해 일관된 조 수준을 유지합니다.
제약 합성	가혹한 시약이 포함된 활성 제약 성분(API) 생산을 위한 반응 용기입니다.	생물학적으로 불활성인 재료는 엄격한 순도 표준 준수를 보장합니다.
화학 물질 보관 및 이송	유리 또는 스테인리스 스틸 용기를 손상시키는 고순도 시약을 안전하게 보관합니다.	견고한 벽 구조는 투과 및 환경 오염을 방지합니다.

매개변수	PL-CP388 사양 세부 정보
모델 식별자	PL-CP388 시리즈
주요 재료	100% 비진(100% Virgin) 고순도 PTFE (PFA 옵션 가능)
제작 방식	완전한 CNC 일체형 가공 (용접 없음)
설계 구성	통합형 내부 및 외부 오버플로우 탱크
치수 범위	고객 사양에 따라 완전히 맞춤화 가능
벽 두께	맞춤화 가능 (구조적 무결성 및 열 전달에 최적화)
작동 온도 범위	-180°C ~ +260°C
화학적 상용성	보편적 (용융 알칼리 금속 및 불소 원소 제외)
오버플로우 위어 스타일	맞춤형 (직선, V-노치, 또는 톱니 모양 옵션)

매개변수	PL-CP388 사양 세부 정보
표면 마감 (Ra)	<0.5 μm (표준) / 더 높은 정밀도로 맞춤화 가능
배수 및 포트	맞춤형 NPT, 플랜지 또는 압축 피팅 제공
하중 용량	맞춤형 부피 및 유체 밀도를 기반으로 엔지니어링됨
세정 프로토콜	표준 클린룸 및 멸균 절차와 호환